

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-313750

(P2002-313750A)

(43) 公開日 平成14年10月25日 (2002. 10. 25)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	キーワード* (参考)
H 0 1 L 21/30		H 0 1 L 21/30	2 H 0 9 6
G 0 3 F 7/40	5 2 1	G 0 3 F 7/40	5 2 1 5 F 0 4 6

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願2001-119546(P2001-119546)

(22) 出願日 平成13年4月18日 (2001. 4. 18)

(出願人による申告) 国等の委託研究成果に係る特許出願 (平成12年度、新エネルギー・産業技術総合開発機構委託研究、産業活力再生特別措置法第30条の適用を受けるもの)

(71) 出願人 599073917

財団法人かがわ産業支援財団

香川県高松市林町2217番地43

(72) 発明者 井上 均

香川県高松市林町2217-43 財団法人かがわ産業支援財団附属 高温高压流体技術研究所内 化学技術戦略推進機構内

(74) 代理人 100102314

弁理士 須藤 阿佐子

Fターム(参考) 2H096 AA25 AA30 HA17 LA30

5F046 AA28

(54) 【発明の名称】 パターン形成方法

(57) 【要約】

【課題】 100 μm以下の微細ピッチの領域で、ミクロンオーダーの厚さを有するパターンを容易に形成できる手法の提供。

【解決手段】 基体上に所望の形状に孔を開けたマスクを設け、マスクの上から物質を付着させることによりマスクの孔の形状通りのパターンを形成するに当たり、該物質を超臨界流体または亜臨界流体に溶解させて微小孔から基体に向けて噴射することを特徴とするパターン形成方法。超臨界流体または亜臨界流体として超臨界状態または亜臨界状態の二酸化炭素を用いる。超臨界流体または亜臨界流体に溶解させる物質は金属アルコキシドまたは金属錯体である。

